

## Für jede Applikation die optimale Methode

Diese Veranstaltung, in deren Fokus GPC/SEC-Trennsäulen, Methodenentwicklung und Applikationen stehen, richtet sich an alle GPC/SEC-Anwender die

- existierende Methoden besser verstehen wollen
- Chromatogramme besser und sicherer interpretieren wollen
- die Robustheit und Reproduzierbarkeit Ihrer Methoden verbessern wollen
- effizient neue und stabile Methoden entwickeln wollen

Für die erfolgreiche Teilnahme spielt es keine Rolle, ob Säulen von PSS eingesetzt werden oder nicht. Im Mittelpunkt stehen Erfahrungsaustausch, Strategien und Konzeptdiskussionen.

Nutzen Sie Ihre Chance direkt mit den Säulenentwicklern von PSS zu sprechen und andere GPC/SEC-Anwender zu treffen!

## Vorläufiges Programm

**09.15 Begrüßung und Vorstellung der Teilnehmer**

**09.30 Von der Gelsynthese bis zur Applikation... GPC/SEC Säulen im Fokus**

Moderne Trennphasen, Auswahl der richtigen Säulenpolarität  
Einfluss von Säulendimensionen, Partikelgröße, Porosität  
Linear-Säulen oder Säulenkombination?  
Mismatch-freie Chromatographie

**10.15 So einfach geht das.... Bessere Ergebnisse mit existierenden Methoden**

Optimierung bestehender Methoden  
Wechselwirkungsfreier Trennmechanismus  
Einfluss von Temperatur und Flussrate  
Verbesserung der Auflösung

**11.00 Kaffeepause**

**11.30 Was mache ich wenn.... Effektive Methodenentwicklung & Trouble Shooting**

Fallstudie für erfolgreiche Methodenentwicklung:  
Von der Probe zum Ergebnis: Richtiges Lösungsmittel, passende Säulen, Zusätze: ja oder nein?

**12.15 Wechselwirkungen in der GPC/SEC? Risiken und Chancen!**

Wie kann man Wechselwirkungen nutzen?  
Trends und Möglichkeiten in der GPC/SEC

**13.00 Gemeinsames Mittagessen**

**14.00 Parallel-Workshops:**

**Workshop 1: Wässrige Applikationen**

Neutrale und anionische Polymere  
Kationische Polymere  
Proteine und Biopolymere

**Workshop 2: Organische Applikationen**

Polare organische Lösungsmittel  
Unpolare organische Lösungsmittel  
Fluorierte organische Lösungsmittel  
Hochtemperatur-Anwendungen

**16.00 Kaffeepause**

**16.30 Abschlussbesprechung und Verabschiedung**

**ca. 17.00 Ende der Veranstaltung**

*Für jede Applikation die optimale Methode*

## Anmeldung und Organisation

Anmeldungen bitte in schriftlicher Form (z.B. mit beiliegendem Formular) an:  
PSS Polymer Standards Service GmbH  
Tagungsorganisation  
Postfach 3368  
D-55023 Mainz  
Tel.: +49-(0)6131-96239-0; Telefax: +49-(0)6131-96239-11  
e-mail: info@polymer.de

## Teilnahmebedingungen

Teilnehmergebühr: Industrie: EUR 490.-  
Universitäten und Institute: EUR 100.-

Beinhaltet die Teilnahme am Seminar, die Kursunterlagen, das Teilnahmezertifikat, die Pausenverpflegung sowie das Mittagessen während des Kurses.

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass bei Abmeldung bis eine Woche vor Kursbeginn ein Stornobetrag in Höhe von 10% der Teilnehmergebühr fällig wird. Bei noch späteren Abmeldungen kann der Teilnehmerbeitrag nicht mehr erstattet werden.

## Veranstaltungsort

Novotel Hotel Mainz, Augustusstr. 6, 55131 Mainz

Optional:

Ü/F im Novotel Hotel Mainz: EUR 130.- pro Tag (Sonderpreis bei Buchung über PSS GmbH)  
(Übernachungskosten werden zusammen mit der Teilnehmergebühr berechnet)

Die o.a. Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Name.....

Firma.....

Abteilung.....

Straße.....

PLZ-Ort.....

Tel.....

Fax.....

Email .....

Rechnungsempfänger:.....

Datum/Unterschrift.....

Bitte schicken Sie mir Informationen zu folgenden Veranstaltungen:

- Kurs 899-0001 GPC-Kurs (Sprache: deutsch)
- Kurs 899-0026 Hands-on Training Viskosität/ Lichtstreuung (Sprache: deutsch)
- PSS GPC in-house Schulung:  
Bitte kontaktieren Sie mich!

### Optional:

Übernachtungen (P/N 899-0002):

Bitte buchen Sie für mich im Novotel Hotel Mainz ein Einzelzimmer (Ü/F). Die Kosten von EUR 130,- pro Tag (Sonderpreis bei Buchung über PSS) werden zusammen mit der Teilnehmergebühr berechnet:

Anreise: \_\_\_\_\_

Abreise: \_\_\_\_\_

- Ich nehme am GPC/SEC-Säulenseminar teil.
  - Ich nehme teil an Workshop 1, wässrig
  - Ich nehme teil an Workshop 2, organisch